DEVELOPMENT OF A POSITRON SOURCE FOR THE ATF

H.IDA, K.YAMADA, A.AOKI, *S.UNO, *J.URAKAWA, *S.KAWABATA, *Y.TAKEUCHI, *Y.NAMITO, *H.HIRAYAMA,*A.MIYAMOTO and *M.YOSHIOKA

NKK Corporation, Engineering Research Center 1-1 Minamiwatarida, Kawasaki-ku, Kawasaki-shi, 210 Japan *KEK, National Laboratory for High Energy Physics * 1-1 Oho, Tsukuba-shi, Ibaraki-ken, 305 Japan

ABSTRACT

The Japan Linear Collider (JLC) requires a positron source which produces 8×10^{11} particles per RF-pulse. A computer simulation shows the possibility of such an intense positron source using conservative technology. In order to verify the performance of the positron source experimentally, a prototype positron source has been designed and is now being manufactured. The prototype positron source consists of stationary target unit, DC solenoid magnets, pulsed flux concentrator, and an accelerating structure. It will be installed downstream of 1.54 GeV S-band linac of the Accelerator Test Facility (ATF).

リニアコライダー実験施設(ATF)陽電子源の開発

1. 概要

リニアコライダー実験施設、ATF(Accelerator Test Facility) は、将来のリニアコライダー、JLC (Japan Linear Collider)¹¹に必要とされる要素技 術の実証及び研究開発を進めるための試験装置で ある。ATFでは、陽電子源の研究開発のために、 1.54 GeV S-Band リニアックの電子を用いた陽電 子生成試験が行われる予定である。これまで、 JLCの陽電子源については、詳細なシミュレーショ ンによる検討結果から、その概要が明かとなって きた^{12]}。JLC陽電子源での最適な入射電子エネル ギーは、10GeVである。したがって、JLCと同等 の条件での試験をATFで行う事は、人射電子のエ ネルギーの点で困難であり、施設建屋の制限もあ るため困難である。そこで、ATFに於ける陽電子 生成試験では、シミュレーションコードの妥当性 の検証、装置の実現性の確証を第一の目的として いる。ここでは、ATFでの試験条件に於ける 最 適な陽電子源装置の解析結果について述べる。

2、陽電子源装置

陽電子源装置は、その機能により(a)人射電子を 陽電子に変換するターゲット部、(b)ターゲット中 で発散した陽電子を集束する位相変換部、及び (c)集束した陽電子を加速する加速部に大別される。 ATFでは、この他に、リニアックで加速された電 子ビームを陽電子源装置に導くビーム輸送系、生 成した陽電子の

測定系、ビームダンプ等が必要となる。図1 に設 置場所であるアセンブリホール内でのATF陽電子 生成試験機器配置を示す。S-Bandリニアックで 1.54GeVに加速された電子が陽電子源装置に入射 し、陽電子に変換される。アナライザーマグネッ トにより電子と振り分けられた陽電子の生成量、 エネルギー等の測定後、ビームダンプに導かれる。

陽電子は、ターゲット内で起こる電磁カスケー ドシャワーにより生成される。陽電子源装置のパ ラメータを最適化するためには、各パラメータの 変化に対する陽電子生成効率の変化を評価しなけ ればならない。ところが、解析的な方法で、電磁 カスケードシャワーを取り扱うことは、困難であ る。ここでは、次章に示すシミュレーション手法 により、陽電子源装置における陽電子の挙動を解 析した。

3.解析手法

ターゲット内での陽電子の挙動については、モ ンテカルロ法による計算コード EGS4¹³ を用いて、 ターゲット出口での陽電子の位置及び運動量を求 める。ターゲットに続いて設置される位相変換部 では、漸減するソレノイド磁場により径方向の運 動量を減少させるAdiabatic Device (以下、ADと略 す)を用いる。この方式は、QWT (Quarter Wave Transformer)方式に比べてエネルギーアクセプタ ンスが大きく、リニアコライダーに適した集束方 式である。漸減する磁場を発生するために、フラッ クスコンセントレーターと呼ばれるパルスマグネッ トを使用する。この位相変換部では、下式で表さ れるADの磁場による陽電子の軌道をルンゲクッ タ法で求める。

 $B_{t} = \frac{B_{0}}{1 + \mu z} \quad and \quad B_{t} \approx -\frac{r}{2} \frac{\partial B_{t}}{\partial z} + \frac{r^{3}}{16} \frac{\partial^{3} B_{t}}{\partial^{3} z} \qquad (1)$ ここで、 B₀ : 初期磁東密度

m :定数(磁東密度の減少率を表す) 位相変換部に続く加速部では、ド式に示す加速 電界を考慮する。

 $E_x = E_y = 0$, $E_x = E_0(\omega - kz + \phi)$ (2) ここで、 ω : $2\pi v$, v = 2856 MHz k : ω/c ϕ : 初期位相

4. シミュレーション結果

4.1 ターゲット厚さ

ターゲットの厚さに対する陽電子生成効率の変 化を図2に示す。ターゲットの材料としては、タ ングステンを選択した。これは、高融点であり、 陽電子生成に効率が良い原子番号が大きな材料だ からである。ターゲットの厚さが4放射長(=14mm)の時に、陽電子生成効率は最大となる。 これは、ターゲットの厚さが増すにつれて電磁カ スケードシャワーが成長により生成する陽電子数 が増加するものの、ある一定の厚さを越えると、 径方向の拡がりのために下流の装置にアクセプト される陽電子が減少するためである。この結果は、 以下に示すターゲットの最適厚さLapeを求める近 似式から得られる4.1放射長とほぼ一致する^[4]。

$L_{opt} = 1.1 \log E + 3.9$		(3)
ここで、E:入射エネルギー	(G e V)	

4.2 入射ビームサイズ

入射ビームサイズが小さくなると、パルス熱応 力によるターゲットの破壊を引き起こされること がある。SLACでの実験では、ターゲットの破壊 が引き起こされる入射電子密度の制限値p⁽⁴⁾とし て、下式が得られている。 ρ \approx NE / $\pi \sigma^2$ < 2×10¹² GeV/mm² (4) ここで、 N:パルスあたりの人射電子数 σ: rmsビーム半径 (mm)

したがって、JLC陽電子源の様なハイパワーター ゲットの場合、ターゲットへの入射ビームサイズ が非常に重要なパラメータとなる。一方、ATFで の陽電子生成試験時には、遮蔽上の制限のために、 入射電子数を6.25 ×10° e/s 以下で運転しなければ ならない。そのため、ATFにおいてターゲットの 破壊が引き起こされる入射電子密度の制限値を上 同るためには、入射ビームサイズを1.5ミクロン 以下にしなければならず、ATFではパルス熱応力 によるターゲットの破壊に関する耐久試験を行う ことは不可能である。

陽電子生成効率の観点から見ると、入射ビーム サイズが小さい程、生成効率は高くなる。図3に ビームサイズによる生成効率の変化を示す。SAD コードを用いて行った軌道解析では、ターゲット 上でのビームサイズを、3σで約1.8mm程度にで きる事が判った。これは、1σで約0.6mmに相当 するが、ビームに拡がりが無い場合(σ=0)と比 べて、生成効率に大きな低下は見られない。

4.3 位相変換部のバラメータ

位相変換部では、(1)式に示したADによる軸方 向の磁場で陽電子の収束を行う。具体的には、径 方向運動量 p,に対する作用積分 J=πp,/eB が緩や かな磁場の変化の中で断熱不変量となるため、漸 減する磁場に伴い、径方向の運動量が減少する。 そこで、適切な初期磁束密度、ADの長さ等が必 要となる。

図4は、ADの長さに対する陽電子生成効率の 変化である。ADの長さが12cmの時、陽電子生成 効率は最大となる。

4.4 加速部のバラメータ

ATFでは位相変換部直後に、ソレノイドマグネットが巻かれた1.5m加速管1 基程度の加速部を設ける予定である。加速部のパラメータは、供給可能なクライストロンのパワーに依存するが、ここでは、100MWが供給可能であるとした。

図5にJLC陽電子源の加速勾配の変化に対する 陽電子生成量を示す^[4]。ここでの生成量は、(4) 式で示した人射電子エネルギー密度の制限に従っ て人射電子数が変化することを仮定している。つ まり、その結果、JLCの場合、加速部のアイリス 直径(2a)が同じであれば、人射電子ビームのサイ ズが大きい程、陽電子生成量は多くなる。これは、 (4) 式から明らかなように、ターゲット上での 熱負荷がビームサイズの2乗で減少するため入射 電子数を増加することが可能となり、ビームサイ ズの増加による生成効率の減少を補っているため である。また、入射ビームサイズが同じであれば、 2aが大きな程、生成量は増加する。

ATFの場合、入射電子数の制限のために、(4) 式の最大許容エネルギー密度まで、電子を入射す ることは出来ない。したがって、陽電子生成量を 増加させるためには、2aが大きな加速管で加速部 を構成する方が有利である。クライストロンパワ ーとして100MWを仮定すると、入口で30mm、出 口で26mmの2aを持つ1.5m長さのCG加速管で、 30MV/mの加速勾配が達成可能である。同等のク ライストロンパワーを用いると、出口の2aが 18mmの加速管で40MV/mの加速勾配が実現可能 であるが、26mmの加速管を使用した場合の生成 量を上回ることは出来ない。加速勾配よりも2aを 大きくする方が陽電子生成に関しては、有利であ る。

5. まとめ

本検討結果より明らかとなったATFで最適な陽 電子生成システムのパラメータを表Iにまとめた。 この時、加速部出日で45MeV±20MeVのエネルギ 一範囲に入る陽電子数は、入射電子1個に対し0.8 となる 空間的な制約が存在するため、加速部を 十分にとることは困難であるが、試験目的である シミュレーションコードの妥当性の確認には充分 なシステムであると考えられる。 陽電子源本体については、平成4年度から5年 度にかけて設計、製作を行っている。今後、加速 部の設計、製作及びビーム測定系の検討を行い、 S-Bandリニアックの完成を待って、陽電子生成試 験を行う予定である。

参考文献

[1] JLC-I, KEK Report 92-16 (1992)

[2] H.Ida, et al., Int. Conf. on High Energy Acc ,

Hamburg, (1992)167-169

[3] W.R.Nelson et al., SLAC-PUB-265, 1985

[4] H.Braun, et. al., SLAC-PUB-5746, 1992

表 I ATF陽電子源装置のパラメータ(JLCの値 と共に示す)

項目	ATF	JLC
[入射電子部]		
コネルギー(GeV)	1.54	1.0
rmsビームサイズ (mm)	0.7	1.2
パルスあたりの電子数	6. 25×10)* 5. 4×10"
練り返し (Hz)	1	150
ビームパワー (KW)	0.04	130
[ターゲット部]		
材質	w	W-26Re
厚さ 4放射日	£ (14mm)	6 放射長 (21mm)

120	180
8.0	8.0
30	3 0
1.5m	1.5m (×2本)
2 6	2.6
0.8	0.8
	1 2 0 8.0 3 0 1.5 m 2 6 0.8





図2 ターゲットの厚さに対する陽電手生成効率 の変化及びターゲット出口でのビームサイズ



図3 ビームサイズの変化に対する生成効率及び ターゲット出口でのビームサイズ (rms)の変化







図5 JLC陽電子源装置の加速勾配の変化に対する 陽電子生成量